PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

61-291966

(43) Date of publication of application: 22.12.1986

(51)Int.CI.

C23C 14/28

(21)Application number: 60-133428

(71)Applicant: AGENCY OF IND SCIENCE &

TECHNOL

MITSUBISHI HEAVY IND LTD

(22)Date of filing:

19.06.1985

(72)Inventor: MINETA YUKISHIGE

YASUNAGA NOBUO TARUMI NOBORU TESHIGAHARA EIICHI IKEDA MASAYUKI ODOHIRA TOSHIHIKO WADA TETSUYOSHI

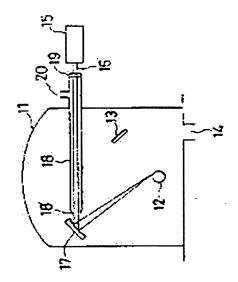
ITANO SHIGEO

(54) VAPOR DEPOSITION DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To make an evaporation device using a light beam practicable by passing gas from the window side into a protective pipe provided in continuation with the light beam introducing window to an admission path for the light beam thereby preventing the sticking of a vaport deposition material to the window.

CONSTITUTION: The laser beam 16 is introduced through the introducing window 19 into an evaporation vessel 11 and irradiated to a reflecting mirror 17 by passing through a slit 18' provided at the front end of the protective pipe 18. The gas is introduced through a gas introducing port 20 into the pipe 18 so that the arrival of the vapor evaporating from an evaporating material 12 coming from the opposite side at the window 19 is prevented. The beam 16 reflected by the mirror 17 is irradiated to the material 12 by which the material 12 is evaporated. The evaporating vapor is deposited on a sample 13 and the film deposited by evaporation is thus formed.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration] [Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61-291966

⑤Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和61年(1986)12月22日

C 23 C 14/28

7537-4K

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

②特 願 昭60-133428

②出 願 昭60(1985)6月19日

砂発 明 者 蜂 田 進 栄 茨城県新治郡桜村梅園一丁目1番4号 工業技術院電子技

術総合研究所内

⑫発 明 者 安 永 锡 男 茨城県新治郡桜村梅園一丁目1番4号 工業技術院電子技

術総合研究所内

術総合研究所内

⑪出 願 人 工 業 技 術 院 長

②復代理人 弁理士 鈴江 武彦 外2名

⑪出 願 人 三菱重工業株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目5番1号

砲代 理 人 弁理士 坂 間 暁 外2名

最終頁に続く

明 細 書

1. 発明の名称

蒸着装置

2. 特許請求の範囲

[産衆上の利用分野]

本発明は、光ビームによって 孤善材料を蒸発させる 蒸着装置に係わり、特に蒸発源(蒸着材料)

からの蔑発蒸気が光ピーム導入のための窓に付着 することを防止した蒸着装置に関するものである。 〔従来の技術〕

一般に真空蒸着においては、蒸発源からの蒸発 蒸気は、基板のみでなくあらゆる方向に進行する ので、例えば観察用の観き窓等にも付着して観察 が不可能になるという問題がある。このため、覗 き窓にシャッターを設け、観察する場合だけシャ ッターを開けることにより、付着を減少しようと する工夫が見られる。しかし、窓を通してレーザ やランプ光等の光ビームを導入し、その光ビーム エネルギーで蒸着材料を蒸発させる蒸巻装置にお いては、この種のシャッターを設けることは不可 能である。そして、蒸着時に前記光ビーム導入窓 に蒸茗蒸気が付着し、その膜厚が厚くなると、光 エネルギーの吸収や反射ロスが増大する。また、 光ピーム導入窓に付着した蒸着膜が光エネルギー を吸収するため、窓が局部的に高温になり破損す るという問題があり、これが光ビームを使用する 蒸着装置を実用化する上での大きな問題となって

特開昭61-291966(2)

いた。

[発明が解決しようとする問題点]

しかしながら、この種の方法にあっては次のような問題があった。即ち、窓39へ向かう蒸気の密度が高いため、ガス流れだけでは蒸気流れを組止することは困難である。また、完全に蒸気流れ

一ムを反射してその反射ビームを前記蒸落材料上に照射する反射 娘と、前記窓から上記反射機に至るまでの光ビームの通路を囲んで配設され、且つ上記反射機の近傍に光ビームの通過するスリットが設けられた保護管と、この保護管の前記窓部近傍に気体を導入し、該保護管内で窓部からスリット方向(反射銀方向)に気体を流す手段とを設けるようにしたものである。

[作用]

上記の構造であれば、光ピームの導入窓に到達する蒸発物質は、スリットを通過しさらに保護管内のガスの流れに逆らって進行する必要がある。 このため、窓に到達する蒸発物質の最は極めて少ないものとなる。

[発明の効果]

従って本発明によれば、保護管内に流すガスの 団を左程多くしなくても、蒸替物質の光ピーム導 入窓への付替を確実に防止することができる。こ のため、光ピームを用いた蒸替装置の実用化に極 めて有効である。 を阻止しようとすると、ガスの導入量を著しく増大させる必要があり、ガス使用量の増大を招く。 さらに、必然的に蒸り容器内の圧力が増大するため、排気ポンプ容量が増大すると云う問題があった。

本発明はこのような問題を解決するためになされたもので、その目的とするところは、光導入に蒸着源からの蒸発蒸気が付着するのを確実に防止することができ、光ビームを用いた蒸着の実用化に寄与し得る蒸着装置を提供することにある。

本発明の母子は、蒸着物質の窓への付替を防止するために、光ビームの導入路に窓とつながる保護管を設け、この保護管内に窓側からガスを洗すことにある。

即ち本発明は、容器内に蒸替材料及び試料を配置し、窓を通して容器内に導入した光ビームを蒸替材料に照射し、 該材料を蒸発せしめることにより試料上に蒸替膜を形成する蒸替装置において、前記容器内に配置され該容器内に導入された光ビ

[実施例]

′以下、本発明の詳細を図示の実施例によって説明する。

第1回は本発明の一実施例を示す機略構成図であり、11は蒸替容器、12は蒸替材料(蒸発源)、13は試料基板、14は排気口、15はレーザ発振器、16はレーザビーム、17は凹面反射鏡、18は保護管、18′は保護管18の端部に設けられたスリット、19はレーザ光導入窓、20はガス導入口を示す。

特開昭61-291966(3)

する蒸気は非常に少ない。しかも、保護管18内の内部は、蒸気進行方向とは逆向きのガス洗れがあるため、蒸気が窓19に到達する確率は極めて低く、工業的には、窓19の汚れは全く問題がないと言える。

一方、蒸気の一部は反射は17に到達するが、
レーザはしたがスが可能は反射は1つ、蒸射が付けられており、、蒸射は1つ、 放射は1つ、 放射は1つである。この反射は1つである。この反射は1つである。この反射は1つである。この反射は1つであるが、例えばCO2レーザ(波長10・たもののでが、例えばCO2レーザ(変長10・たもののでであり、たとことができる。

このように本実施例によれば、光ピームの導入 窓19に対する蒸発蒸気の付着を確実に防止する ことができる。しかも、保護間18内に流すガス

蒸替材料に照射する光はレーザ光に限定されるものではなく、蒸替材料を十分に加熱できるものであればよい。また、前記保護管内に流すガス最は、保護管の長さや蒸替容器内の圧力等の条件に応じて適宜定めればよい。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例に係わる蒸着装置を示す概略構成図、第2図は他の実施例を示す概略構成図、第3図は従来装置を示す既略構成図である。

出願人復代理人 弁理士 鈴江武彦

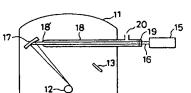
の 量も少なくて 済む。 この ため、 光ビームを 利用 した 蒸着装置の 実用 化に 極めて 有効である。

第2図は本発明の他の実施例を示す図である。 なお、第1図と同一部分には同一符号を付して、 その詳しい説明は省略する。17′は平面反射焼、 21はレーザ光を集光するためのレンスを示す。 この実施例が先に説明した実施例と異なる点は、 前記凹面反射鏡17の代りに、レンス21により 光ピームを集束することにある。

この実施例においても、先の実施例と同様に窓
19や反射鏡17′への蒸発蒸気の付着は見られないが、本実施例の場合はレンス21によって集光しているため、反射鏡17′は平面鏡で良く、またスリット18′を小さくすることができるため、反射鏡17′に吹付けられるガスの圧力を上げることができ、反射鏡17′の蒸気の付着をさらに減少することが可能である。

なお、本発明は上述した各実施例に限定される ものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で、種々変形して実施することができる。例えば、前記

1 数

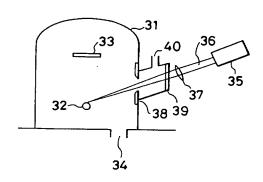


第 2 図 18 18 19 15 12 21 16

The State of Lines in

特開昭61-291966(4)

第 3 図



第1頁の続き					
⑫発	明	者	勅 使 川 原	永 一	茨城県新治郡桜村梅園一丁目1番4号 工業技術院電子技術総合研究所内
⑫発	明	者	池 田	正幸	茨城県新治郡桜村梅園一丁目1番4号 工業技術院電子技術総合研究所内
⑦発	明	者	尾土平	俊 彦	広島市西区観音新町 4 丁目 6 番22号 三菱重工業株式会社 広島研究所内
⑫発	明	者	和田	哲 義	広島市西区観音新町 4 丁目 6 番22号 三菱重工業株式会社 広島研究所内
⑫発	明	者	板 野	重夫	広島市西区観音新町 4 丁目 6 番22号 三菱重工業株式会社 広島研究所内